

R2R等离子清洗设备

可进行去胶渣、表面清洁、活化、改善、接枝或粗糙化等

特点

- 配备真空收料循边专用模组，确保收料精度
- 采用闭回路张力控制系统，确保张力控制稳定性
- 远端控制系统，即时了解设备状态提升稼动率
- 低张力传输，降低膜料胀缩量
- 采用多组水冷电极，提升处理效能、增加产能
- 水冷滚轮有效控制材料温度，提高制程稳定性
- 腔体设计采用收、放卷与制程分区，避免污染、腐蚀
- 专利快速安全夹头，减少上下料操作时间
- 特殊之气体进气、扩散及抽气系统设计



R2R等离子清洗设备

项目	规格
设备体积 (W×D×H)	3160mm×2950mm×2450 mm
工作参考面积 (D×W)	5400mm×5300mm
真空腔体 (W×D×H)	2470mm×1280mm×1860mm
需求电源	3相 220V , 60Hz , 4wires , 250A
Power Output	10KW MF power supply
Process line	8m
适用料卷幅宽	600mm(max)
适用料卷直径	Ø600mm(max) ; plastic core(3"or 6")
滚轮尺寸	直径100mm×宽800mm
线速度	1~10m/min
张力控制	30Nt~100Nt (3~10Kg)
循边导正	±1mm
制程气体	Ar、O ₂ (可扩充)

